

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于ASML-1400光刻机进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司购买光刻机设备进展概况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）自立项开发 193nm ArF干法光刻胶的研发及产业化项目以来，安排购买了ASML-1400光刻机等核心设备，并于2020年12月14日在《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》中披露，该光刻机将于 2020 年底前运抵国内。后由于公司与光刻机供应商、北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司（以下简称“合作方”）沟通协调设备运输与安装等细节，致使设备没能在规定时间内运达，但与合作方就具体合作细节签署了《合作框架协议》，并发布了《关于ASML-1400光刻机进展暨签订<合作框架协议>的公告》，预计该光刻机将于2021年3月底前进入合作方现场，详见公司于2021年1月5日发布的相关公告。

现经各方积极协商、运作，该光刻机设备于今日已进入合作方北方集成电路技术创新中心（北京）有限公司场地，后续将进行安装调试等相关工作。

#### 二、对公司的影响及风险提示

1、公司采购的 ASML 干法光刻机设备顺利交付，对加快 193nm ArF 干法光刻胶产品开发进度有积极影响，有利于进一步提升公司光刻胶产品的核心竞争力，加快落实公司发展战略，提高公司抗风险能力和可持续发展能力。

2、该光刻机尚须经过装机、调试等相关环节，若相关环节出现工作疏漏或失误则存在造成所购买的光刻机投入使用的过程较长甚至无法投入使用的风险。

3、光刻胶研发项目技术壁垒高、周期长、至产业化并最终实现销售利润仍需一定时间，而公司购买的光刻机设备价格昂贵，其折旧及后续维护费用预计对

公司的经营业绩存在一定影响。

敬请投资者注意投资风险。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2021年3月8日